

*Катя Върблянска, Пламен Гърдев.* КИНЕТИКА НА ИЗРАСТВАНЕ И ОПТИЧНИ СВОЙСТВА НА Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> СЛОЕВЕ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ НИСКОТЕМПЕРАТУРНА ОКСИДАЦИЯ НА Ta

Проведено е нискотемпературно частично оксидиране при 350°C и 400°C на високочестотно-магнетронно разпръснат танталов слой в атмосфера на сух и наситен с водни пари кислород. Нискотемпературният режим е съобразен с нестабилността на интерфейса Ta-GaSb при производство на шотки-фотодиодни структури. Изследвани са дебелината, структурата и оптичните свойства на слоя Ta+Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub> в зависимост от температурата на оксидиране ( $T_{\text{ох}}$ ), времето на оксидиране ( $t_{\text{ох}}$ ) и средата.